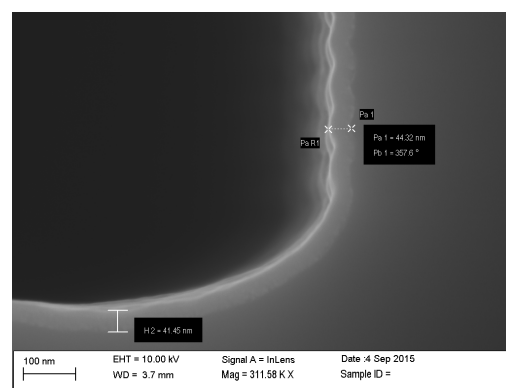
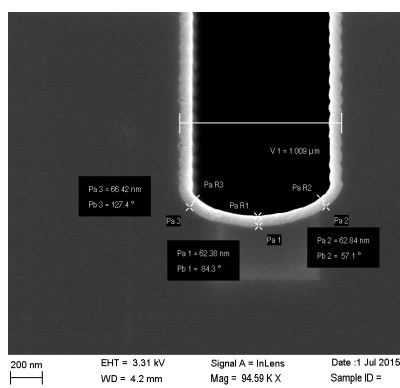
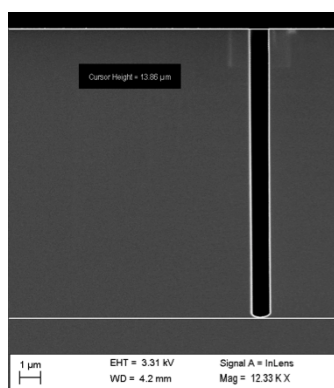
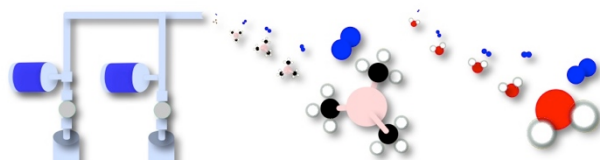


# Atomic Layer Deposition

## 原子層堆積装置



### 原子層堆積(ALD)装置 Model: AT-400

原子レベルでの膜厚コントロールが可能で、対象物の形状への追従性(Conformity)に優れたALD。様々な材料が利用できるこのナノレベル成膜技術を小型で簡易使用を可能にしました。半導体デバイス、次世代太陽電池、有機デバイス、燃料電池やリチウム電池の表面改質、ナノワイヤー、グラフェン、CNT、ナノパーティクルなどナノテクノロジー研究で使用可能です。

# Anric Technologies社製

項目	仕様
設置面積	幅:493 x 奥行:454 x 高さ: 395mm
基板(試料)最大サイズ	4インチ (100mm)
プリカーサー	最多5ライン (有機金属 3ライン含む)
プリカーサー投入量	安定供給方式
加熱方式	ホットウォール式
反応室の最高温度	350°C
標準プロセス	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , TiO <sub>2</sub> , ZnO, ZrO <sub>2</sub> , HfO <sub>2</sub> , Pt, Ru (その他プロセス開発もご相談ください。)

## ユーティリティ



項目	仕様
プリカーサーボトル	50cc、ボールバルブ付、VCR
プリカーサー加熱	(オプション) 最高150°C
キャリアガス	高純度N <sub>2</sub> (又はAr)、VCR
バルブ駆動用エア	約4.3Kg/cm <sup>2</sup> (約450kPa)、1/4"
真空ポンプ	ロータリーポンプ (>230L/min)
排気ライン	NW25 (1")
電源	100/200V, 単相 (50/60Hz)

輸入総代理店:

ALDジャパン株式会社

〒183-0056 東京都府中市寿町1-3-10-401

Phone&Fax: 042-360-3152

E-mail: [info@aldjapan.com](mailto:info@aldjapan.com)

 [www.aldjapan.com](http://www.aldjapan.com)